

## SprayCVD-050

Reactor Espray CVD 2" económico  
Posibilidad de recocido rápido in-situ



### APLICACIONES

- Células solares : SnO<sub>2</sub>, ZnO, TiO<sub>2</sub>, In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,...
- Capas electro-ópticas : NiO, Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub>,...
- Memorias ferroeléctricas : SrTiO<sub>3</sub>,...
- Capas barreras aislantes : MgO,...
- Capas catalíticas : Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub> , NiCo<sub>2</sub>O<sub>4</sub>,...
- Semiconductores : Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>,...
- Supraconductores : YBCO,...
- Capas electrocromos : WO<sub>3</sub>,....
- Pilas a combustible a óxidos sólidos (SOFC) : ZrO<sub>2</sub>, YSZ, GCO,...

[www.annealsys.com](http://www.annealsys.com)

### ESPECIFICACIONES

El horno AnnealSys SprayCVD-O50 es un reactor aerosol CVD de 2 pulgadas desarrollado para las aplicaciones de investigación y desarrollo de los laboratorios.

El calentamiento por lámparas infrarrojas autoriza recocidos in-situ en la cámara de depósito.

La máquina puede ser equipada de la Atokit Kemstream para la atomización del precursor y la generación del aerosol.

El sistema puede funcionar al vacío y mezclar gases.

La máquina aerosol CVD es surtida con un PC y su software de control que funciona bajo Windows para el control y la adquisición de los datos de proceso.

### CARACTERÍSTICAS

- Talla máxima de los substratos: 2"x2"
- Rango de temperatura del ambiente a 1200°C
- Líneas de gas con controlador numérico de flujo
- Rango de presión del atmosfera hasta 10<sup>-3</sup> Torr

## SprayCVD-050

### Características generales

Talla máxima de los substratos	2 pulgadas
Cámara de proceso	Tubo cuarzo con bridas de acero inoxidable enfriadas por agua
Calentamiento	Horno con lámparas halógenas infrarrojas Enfriamiento silencioso de las lámparas por ventiladores En opción, selección de calentamiento por abajo y/o arriba
Regulación de temperatura	Regulación por termopar Regulador de temperatura PID numérico rápido
Vacío y gas	Línea de purga con válvula de aguja Hasta 3 líneas de gas con controlador de débito de flujo Atokit Kemstream para la atomización del precursor Válvula de vacío y sensor de vacío Opción bomba de vacío Opción control de presión con válvula mariposa
Control	Control completo por PC, hasta 100 etapas por receta Comunicación Ethernet con el horno para adquisiciones rápidas Fichero de histórico proceso y seguido de producción
Alimentaciones	Tensión : 3x400V+N+Gr o 3x220V+Gr, 50/60 Hz Potencia : 15 kW Agua : 2 a 6 bars, pérdida de carga 1 bar, 8 l/mn Aire comprimido : 6 bars (Control de las válvulas) Racores de gas : Swagelok ¼
Dimensiones y peso	Anchura: 700 mm Altura: 700 mm Profundidad : 700 mm Peso : 90 kg

[www.annealsys.com](http://www.annealsys.com)

**ANNEALSYS**

Bat T2, PIT de la Pompignane  
Rue de la Vieille Poste  
F-34055 Montpellier Cedex 1  
Tel: +33 467 20 23 63  
Fax: +33 467 20 26 89  
Email: [info@annealsys.com](mailto:info@annealsys.com)